

REFERENCES

REFERENCES :

- 1) Chopra K L, Thin Film Technology and Applications" (eds) Chopra K L and Malhotra L K, TMS Publishing Co. New Delhi P.1 (1985)
- 2) Barroughes J H, Bradley D D C, Brown A R, Marks R N, Macay K, Friend R H, Burns P L , Holmes A B, Nature 347, 539 (1990)
- 3) Forrest S R, Kaplan M L, Schmidt P H, J. Appl.Phys., 55, 1492 (1984)
- 4) Sheats J R, Antoniadis H, Hueschen M, Leonard W, Miller J,Moon R, Roitman D, Stocking A, Organic Electroluminescent Devices Science 273, 884 (1996)
- 5) Forrest S R, Ultra thin Organic films Grown by Organic Molecular Beam Deposition and related techniques, Chem. Rev. 97, 1793 (1997)
- 6) Liu C Y, Bard A J; Optoelectric Charge Trapping/Detrapping in Thin Solid Films. Chem. Matter, 10, 840 (1998)
- 7) Prasad B, Mishra P K, Ind. J. Pure and Appl. Phys. 32, 328 (1994)
- 8) Schmidt A, Schuerlein T J, Collins G E, Armstrong N R; J. Phys. Chem. 99, 11770 (1995)
- 9) Pagnot T, Audebert P, Tribillon G; Chem. Phy. Lett. 322(6), 527 (2000)
- 10) Razeghi M, Sandvik P, Kung P, Walker D, Mi K, Zhang X, Kumar V, Diaz J, Shahedipour F; Mater. Sci. Eng. B B74 (1-3), 107 (2000)
- 11) Barth KW, Lau J E, Peterson G G, Endisch D, Kalayeros A E, Tuenge R T, King C N; J. Electrochem. Soc; 147(6), 2174 (2000).
- 12) Kaur I, Pandya D K., Chopra K L; J. Eloectrochem. Soc, 127, 943 (1980)

- 13) Chopra K L, Kainthla R C, Pandya and Thakoor A P; *Phys. of Thin films*, vol.12,(Hass G, Fraoncombe M H and Haffman eds) Academic Press, New York (1982)
- 14) Matrox D M, *Deposition Technologies for Thin Film and Coating*, Noyes Publications, New York (1982)
- 15) Cook, Michael J, *Pure Appl. Chem.* 71(11), 2145 (1999)
- 16) Sluch M I, Vitukhnovsky A G, Petty M C; *Thin Solid Films*, 284, 622 (1996)
- 17) Veluswamy V S, Balsubramaniam C, Radhakrishnan M, *J. Mat. Sci. lett.*, 3, 1025 (1984)
- 18) Somma F, De N E, Mancini A, Montereali R M, Cremona M, Mauricio MHF, Fehlberg L V, Carbo L C, Scavarda D O; *Adv. Sci. Technol.* 27, 328 (1999)
- 19) Wen, Weng-Kou, Jou Two-Huli, Wu Hua-Shu, Cheng C L; *Macromolecules*, 31 (19), 6515 (1998)
- 20) Chichibu S, Shioda T, Ine T,Nakanishi H; *J. Appl. Phys.* 84(1), 522 (1998)
- 21) George J, Dekker M, INC; New York (1992)
- 22) Chingwu W, Boshao S, Chen Jing-Yu, Chung Tung T, Chen Chin-Liang; *Proc. SPI Int Soc. Opt. Eng.* 4078, 562 (2000)
- 23) Behrisch R ed. *Topics in Appl. Phy.* Vol 47, *Sputtering by Particle Bombardment*, Springer –Verlag, Berlin (1981)
- 24) Rodriguez-Llorente S, Aroca R, Duff J, de Saja J A; *Thin Solid Films*, 317, 129 (1998)
- 25) Vincett P S, Polovic Z D and Mc Intyre L; *Thin solid Films* 82, 357 (1981)

- 26) Romain N, Orsal G, Artard M C, Duchemin S; Diffus. Defect Data, Pt B, 67-68, 373 (1999)
- 27) Mckittrick J, Bacalski C F, Hirata G A, Sze R C, Mourant J, Salazar K V, Trkula M; Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng. 3343, 523 (1998)
- 28) Wessels, Bruce W, Block Bruce A; U.S. US 6122429 A P.14, 2000.
- 29) Peng Li, Chua Soo-jin, Feng Zhe Chung, Wang W, Hao Maosheng Sugahara, Tomoya, Sakai Shiro; Proc SPIE-Int Soc. Opt. Eng. 3899, 63 (1999)
- 30) Suryanarayana C V, Laxman A S, Subramanian V and Kumar R K; Bull Elect. Chem.; 2, 57 (1986)
- 31) Deshmukh L P, Palwe A B, Sawant V S; Solar Cells, 28, 1 (1990)
- 32) Boyle D S, Bayer A, Heinrich M R, Robbe O, O Brien P, Thin Solid Films, 361, 150 (2000)
- 33) Mahrt J, Willig F, Storck W, Weiss D, Kietzmann R, Schwarzburg K, Tufts B, Trosken B; J. Phy. Chem. 98, 1888 (1994).
- 34) Weiss D, Kietzmann R, Mahrt J, Tufts B, Storck W and Willig F; J. Phy. Chem. 96, 5320 (1992)
- 35) Akimoto S, Ohmori A and Yamazaki I; J. Phy. Chem. B. 101 (19), 3753 (1997)
- 36) Roberts G G, McGinnity T M, Barlow W A and Vincett P S; Thin Solid Films, 68, 223 (1980)
- 37) Tamai N, Matsuo H, Yamazaki T and Yamazaki I; J. Phy. chem.. 6550 (1992)
- 38) Vincett P S, Barlow W A; Thin solid Films, 71, 305 (1980)

- 39) Golego Nickolay, Studenikin S A; J. Electrochem. Soc. 147(5), 1993 (2000)
- 40) Hollingsworth J A, Buhro W E, Hepp A F Jenkins P P, Stan M A; Mater. Res. Symp. Proc., 495, 171 (1998)
- 41) Fossum R D, Marye Anne Fox; J. Phy. Chem. B. 101, 6384 (1997)
- 42) Miller E K, Hingerl K, Brabec C J, Heeger A J, Sariciftci N S; J. Chem. Phys., 113, 2 (2000)
- 43) Umeuchi S, Nishmura Y, Yamazaki I, Murakami H, Yamashita M, Ohta N; Thin Solid Films, 311, 239 (1997)
- 44) Ohta N, Kanada T, Yamazaki I, Ito S, Suzuka I; J. Lumin, 79, 177 (1998)
- 45) Hrdlovic P, Chmela S; J. Photochemi and Photobiology A. Chem. 118, 137 (1998)
- 46) Ludmila Eckertova; Phys. of Thin Films, Second Ed., SNTL Publishers of Technical Literature Prague 75,
- 47) Jung S H and Kim H K; J. Luminescence, 87, 51 (2000)
- 48) He Z, Milburn GHW, Baldwin K J, Smith D A, Danel A , Tomasik P; J. Luminescence, 86, 1 (2000)
- 49) Omar O, Ray A K et al; Supra Molecular Science 4, 417 (1997)
- 50) Vakusic P S, Sambles J R, Wright J D; J. Mat. Chem. 2, 1105 (1992)
- 51) Cook J M, Miles D A, Poynter R H et al; J. Mat. Chem. 4, 1205 (1994)
- 52) Puech K, Frob H, Hoffman M, Leo K; Optics Letters vol. 21, 19 (1996)
- 53) Yoshiaki H, Uzumak K Y, Yutaka T S, Koka Tokkyo Koho JPN; Jp 11108862 A2 23 Heisei P 9 (1999)
- 54) Hedi M, Hideyuki M, Merritt Charles D, Kafafi Zakya H; Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng. 3476, 49 (1998)

- 55) Pointer L R, Riedinger T S, Birkhoff R D, Heller J M; *J. Appl. Phys.* 51(3), 1747 (1980)
- 56) Grangvist C G, Hunderi O; *J. Appl. Phys.* 51(3), 1751 (1980)
- 57) Kudo Rieko Kotani Masahiro; *Mol. Cryst. Liq. Cryst. Sci. Technol. Sect. A* 315, 471 (1998)
- 58) McKittrick J, Bacalski C F, Hirata G A, Sze Rc, Mourant J; *J. Solid State Chem.* 138(2), 290 (1998)
- 59) Rack Philip D, Potter Michael D, Kurinec Santosh, Park Wounjang, Penczek John, Wagner Brent K, Summers Christopher J; *J. Appl. Phys.* 84(8), 4466 (1998)
- 60) Abrahams S C, Robertson J M, White J G; *Acta Cryst.* 2,223 (1949)
- 61) Mathieson A Mc, Robertson J M, Sinclair V C, *Acta Cryst.*, 3, 245 (1950)
- 62) Basak B S, *Acta Cryst.* 1, 224 (1948)
- 63) Basak B S. *Ind. J. Phy.* 24, 309 (1950)
- 64) Burns D M, Iball J; *Proc. Roy. Soc. (London) A* 257, 491 (1960)
- 65) Donaldson D M, Robertson J M, White J G; *Proc. Roy. Soc. (London) A* 220, 211 (1953)
- 66) White J G; *J. Chem. Soc.* 1398 (1948)
- 67) Robertson J M; *Proc. Roy. Soc. (London) A* 207, 101 (1951)
- 68) Castella M, Prochrow, Tramer A., *J. Chem. Phys.* (5), 2511 (1984)
- 69) Ibrayer N K, Latonin V A; *J. Lumin.* 87, 760 (2000)
- 70) Sluch M I, Samuel I D W, Petty M C; *Chem. Phy. Lett.*, 280, 315 (1997)
- 71) Lee J I, Klaerner G, Miller R D; *Polym. Prepr.* 39(2), 1047 (1998)
- 72) Hrdlovic P, Chmela S; *J. Photochem. and Photobiol., A* 105(1) 83 (1997)

- 73) Hrdlovic P, Cukal I; J. Photochem & Photobiol. A, 133 (1-2), 73 (2000).
- 74) Sasaki D Y, Singh S C, Jimmy D P, Phillip I; Sens. Actuators B, B 72(1), 51 (2001)
- 75) Mal'tsev E I, Lypehko D A, Shapiro B I, Milburn G H W, Wright J, Hendriksen A, Berendyaer V I, Kotov BV, Vannikov A; Poro-SPIE. Int. Soc. Opt., Eng. 3797, 246 (1999)
- 76) Taski M, Ictsikawa A, Odaki T, Takagi K; Eur. Pat. Appl., I P 890996, A₂, 22 (1999)
- 77) Salito S, Kikan Kagakn Sosetsu, 35, 232 (1998) Japan
- 78) Maruta, Nukihiro, Japan Kokai Tokkyo Koho Jp 08050992 A₂ (1996) Japan.
- 79) Woopyo S, Phil Lee S, Sung Lee H, Kwan K O, Sue H H, Hee Lee S, Ha Y K, Kwan Kim Y, Soo Kim J, Thim Solid Films, 363 (1,2) 232 (2000).
- 80) Ouyong J, Zheng W, Huang N, Zhan Z, Jinan Daxue Xueba O, ZiranKexue Yu, Yixueban, 20(3), 88 (1999) (Chinese).
- 81) Zhao Wel-Ming, Zhu Wen-ning, Zhang Bu-Xin, Jiang Xuie-yin, Zhang Zhi-Lin and Xu Shao-hong; Faguang Xuebao 21(i), 78, (2000) Chinese.
- 82) Posch P, Thelakkat M and Schmidt H.W.; synth. Mate. 102 (11-3), 1010 (1999).
- 83) Kanbara H, Asobe M, Kubidera K, Kaino T, Appl. Phys. Lett. 61, 2292 (1992).
- 84) Tang C.W., Vanslyke S A, Appl. Phys. Lett. 51, 913 (1987).
- 85) Shn Yih Min, Lin H H, Jung Fuhshyang, Tasi Y.S, Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng. 3939, 236 (2000).

- 86) Greenham N C, Moratti S C, Bradle DDC, Friend R H, Holmes A B; Nature 365, 628 (1993).
- 87) Kim H K, Ryu M K,Kim K D, Lee S M, Park J W, Macromolecules 31, 1114 (1998).
- 88) Papadopoulos, Nucl. Instrum. Methods, Phys. Res. Sect. A 434 (2/3) 337 (1999).
- 89) Duclos S J, Electrochem Soc. Interface 7(2), 34 (1998).
- 90) Chauah B J, Li X-O, Cacilli F, Daries J E, Feeder C N, Friend C R H, Garnier F, Holmes A B, Moratti S C,, Sirringhaus H, Annu. Tech. Conf. Soc. Plast, Eng (56) Vol.2, 1321 (1998).
- 91) Palmans A, Andrea W, Christoph S and Paul; Mater Res. Soc. Proc., 558, 293 (2000).
- 92) Liu Xu, Li, Fang-hong, Gu, Pei-Fui, Tang Jin-Fo, Optical Society of America, 385 (1998).
- 93) Yang Cheng-Chung, Chung Chih Chang, Hzin-hua,Chen Chieh wei; Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng., 4079, 135 (2000).
- 94) List E J W, Graupher W, Wohlgenaunt M, Leising G, Partee J, Shinev J, Schtichting P, Rohro G Y, Scherf U, Mullen K, Pot. Mater. (Amsterdam) 9 (1-4) (1998).
- 95) Kido J, Fakui T, Toki M; Jpn Kokai Tokkyo Koho JP,10199681 A₂ 31 Jul (1998).
- 96) Zovko C I, Nerz T C; Displays, 20(3), 155 (1999).
- 97) Ma Dongee, Wang Daile, Hang Zhiyong, Zhao Xiao, Jiang, Jing,k Xiabin, Wang Fosing; Synthe Mat. 91(1-3) 331 (1997).

- 98) Tasch S, List ESW, Ekstram O, Graupner W, Leising G, Schlichting P, Rohr U, Geerts Y, Scherf U, Mullen K.; *Appl. Phys. Lett.* 71 (20), 2883 (1997).
- 99) Konstanda K P, Fotoni D, Kallitsis J K; *J. Poly. Sci. Part A, Polym. Chem.*, 37 (20), 3826 (1999).
- 100) Sangster R C, Irvine J W; *J. Chem. Phys.* 24, 670 (1956).
- 101) Caminati G, Gabrielli G, Ricceri R, Turvo C, Turvo N J, *Thin Solid Films*, 218, 284 (1996).
- 102) Ide R, Sakata Y, Misumi S, Okada T, Mitaga N, *Chem. Commun.* 1009 (1972).
- 103) Mataga N, Ottolenghi M, in R. Foster (Ed) *Molecular Association Vol 2.* Academic London p.1 (1979).
- 104) Staerk H, Kiihnle W, Treichel R, Weller A.; *Chem.Phys. Lett.* 118, 19 (1985).
- 105) Weller A, in; V. Balzani (Eds.) *Supramolecular Photo Chemistry*, D. Reidel Publishing, Dordrecht, The Netherlands 343 (1987).
- 106) Lemmetyinen H, Ikonen M, Mikkolo J; *Thin Solid Films*; 204, 417 (1991).
- 107) Dupartail G, Lianos P; *Phys. Lett.* 165, 35 (1990).
- 108) Petty M C; *Langmuir-Blodgett Films* (Cambridge) University Press (1996).
- 109) Williams G, Soi A, Hirsch A, Bryce M R, Petty M C; *Thin Solid Films*, 203, 73 (1993).
- 110) Williams G, Pearson C, Bryce M R, Petty M C; *Thin Solid Films*, 209, 150 (1992).
- 111) Ohmori S, Ito S, Yamamoto; *Macromolecules* 23, 4047 (1990).

- 112) Ohta N, Umeuchi S, Kanada T, Nishimura Y, Yamazaki I; Chem. Phys. Lett., 277, 215 (1997).
- 113) Seyfang R, Port H, Fisher P, Wolf H C; J. Lumin. 51, 197 (1992).
- 114) Pearson W B; General Editor, Structure Reports published for the international Union of Crystallography by N.V.A. Uoshtocks Vitgevers, MIJ Utrecut R.R. 558, [06]/STR.
- 115) Cullity B D; Elements of X-ray diffraction, Second Edn. Addison-Wesely Publishing Comp. Inc. USA 102 (1978).
- 116) Gomez U, Leonhardt M, Port H, Wolf H C; Chem. Phys. Lett., 268, 1 (1997).
- 117) Chu N YC, Kowaka K and Kearnsa D R; J. Chem. Phys. 55, 3059 (1971).
- 118) Steven B; Spectrochemica Acta; 18, 439 (1961).
- 119) Jadhav S A, Pujari S R, Patil S R; Ind. J. Pure & Appl. Phys. 38, 43 (2000).
- 120) Bazilevskaya N S, Cherkasov A S; Opt. Spectrosc. 18, 30 (1965).
- 121) Werner T C, Hercules D M; J. Phys. Chem., 73, 2005 (1969).
- 122) Suzuki S, Fujii T, Yoshiike N, Komatsu S, Inda T; Bull Chem. Soc. JPN 51, 2460 (1978).
- 123) Ghoneim N, Scherrer D, Suppan P; J. Lumin. 55, 271 (1993).
- 124) Barashleov, Sakhno, Navmukhametov Karpov Inst. Phycem. Moscow Russia, 124, 187 (1996).
- 125) Momiji I, Yoza C, Matsui K; J. Phy. Chem. B. 104, 1552 (2000).
- 126) Agbaria R A, Butterfield M T, Warner I M; J. Phy. Chem. 100, 17133 (1996).